

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成 24 年 7 月 26 日 (2012.7.26)

【公開番号】特開 2010-37559 (P2010-37559A)

【公開日】平成 22 年 2 月 18 日 (2010.2.18)

【年通号数】公開・登録公報 2010-007

【出願番号】特願 2009-175533 (P2009-175533)

【国際特許分類】

C 0 9 D 11/00 (2006.01)

B 4 1 J 2/01 (2006.01)

B 4 1 M 5/00 (2006.01)

C 0 9 C 1/30 (2006.01)

C 0 9 C 3/08 (2006.01)

C 0 9 C 3/12 (2006.01)

【 F I 】

C 0 9 D 11/00

B 4 1 J 3/04 1 0 1 Y

B 4 1 M 5/00 E

C 0 9 C 1/30

C 0 9 C 3/08

C 0 9 C 3/12

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 6 月 13 日 (2012.6.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

インク・キャリアであって、

疎水基で表面修飾されたシリカ・ナノ粒子、又は疎水基で表面修飾された金属酸化物ナノ粒子のうちの少なくとも 1 つの分散体であって、その内部で離散的に分布した前記ナノ粒子の実質的に均一な分布を示す分散体を含み、

前記インク・キャリアはその内部に分布した前記ナノ粒子の実質的な凝集に対する抵抗性を有する、

ことを特徴とするインク・キャリア。

【請求項 2】

着色料及び請求項 1 に記載のインク・キャリアを含むことを特徴とする、相変化インク。

【請求項 3】

前記疎水基はアルキル基、アリールアルキル基又はアルキルアリール基であり、
或いは、

前記疎水基は、少なくとも 1 つのヘテロ原子を有するアルキル基、アリールアルキル基又はアルキルアリール基である、

ことを特徴とする、請求項 1 に記載のインク・キャリア。

【請求項 4】

前記疎水基はポリジメチルシロキサン又はヘキサジメチルシランであることを特徴とす

る、請求項 1 に記載のインク・キャリア。

【請求項 5】

低融点ワックスをさらに含むことを特徴とする、請求項 1 に記載のインク・キャリア。

【請求項 6】

120 未満の融点を有する低融点ワックスをさらに含むことを特徴とする、請求項 1 に記載のインク・キャリア。